



SEMINAR:
Plasma Prozesstechnologie

am Donnerstag, den 28. Februar 2013
in Berlin-Adlershof
Veranstaltungsort:
SENTECH Instruments GmbH
Schwarzschildstr. 2, Berlin-Adlershof
Tel.: +49 30 6392-5520

Seminarprogramm

9.00 **Begrüßung / Vorstellung des Programms**
SENTECH GmbH, Krailing

Beschichtungstechniken

9.15 **PECVD- und ICPECVD-Abscheidung und Charakterisierung von Si-Oxiden, -Nitriden und -Carbiden**
Xuemei Wang, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

9.45 **Abscheidung von hochqualitativen Si-Nitrid-Schichten mit niedrigem Wasserstoffgehalt durch Abscheidung mit ICPECVD**
Wolfgang Bronner, Fraunhofer Institut für Angewandte Festkörperphysik, Freiburg

10.15 **Kontrollierte konforme nano-skalige Abscheidung funktionaler Schichten mit thermischer und plasmaunterstützter ALD**
Hassan Gargouri, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

10.45 Kaffeepause und Diskussion

11.00 **Dünnschichtverkapselung von organischer Elektronik mittels Atomlagenabscheidung**
Tim Bülow, TU Braunschweig, Institut für Hochfrequenztechnik, Braunschweig

Ätztechniken

11.30 **Si-Strukturierung für die Herstellung von MEMS und Sensorik**
Ralph-Stephan Unger, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

12.00 **Ätzen von GaN-Schichten**
Wilfried John, Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin

12.30 Mittagessen und Diskussion

13.30 **Strukturieren von Glas und Quarz**
Eric Markweg, TU Ilmenau, Fachgebiet Mikromechanische Systeme, Ilmenau

14.00 **Nanostrukturiertes Silizium in der Photovoltaik und Sensorik**
Martin Steglich, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Angewandte Physik, Jena

14.30 **Vorteile induktiv gekoppelten Plasmas in der SI 500 gegenüber kapazitiv gekoppelten Plasmen**
Michael Arens, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

15.00 Kaffeepause und Diskussion

15.15 **Endpunktdetektion mit dem neu entwickelten SENTECH Laserinterferometer**
Tomasz Kwapien, SENTECH Instruments GmbH, Berlin

15.45 **Moderne elektronische Bauelemente auf der Basis von Graphen**
Christian Wenger, IHP, Frankfurt (Oder)

16.15 **Alle Teilnehmer des Seminars sind zum Besuch des Applikationslabors bei SENTECH Instruments eingeladen**

17.15 Ende des Seminars